

<第 263 回講演会>

日 時： 2025 年 4 月 24 日(木) 13:30～17:00

会 場： オンライン(Zoom)での開催

テーマ： 『次世代リソグラフィ技術の展開』

フォトポリマー懇話会会員：無料(人数制限なし)

非会員：3,000 円、学生：2,000 円(4 月 17 日(木)までにお振り込みください)

テキストはダウンロード方式とします。

[参加申込]

フォトポリマー懇話会ホームページ www.tapj.jp のメールフォームからお申し込みください(4 月 17 日(木)締切)

[プログラム]

1. 13:30～14:30

「EUV リソグラフィの現状と課題」

兵庫県立大学 渡邊 健夫氏

2. 14:40～15:40

「EUV レジスト材料の反応機構、高性能化とメタルレジスト材料の性能評価」

量子科学技術研究開発機構 山本 洋揮氏

3. 15:50～16:50

「半導体産業の歴史と半導体用フォトレジストの開発」

大阪公立大学 堀邊 英夫氏

4. 16:50～17:00

ブレイクアウトルーム